

令和7年3月21日

三次元半導体研究センター  
ご利用の皆様

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団  
理事長 津田 純嗣  
(三次元半導体研究センター)

### 新型装置の導入等に伴う機器利用料金改定について（お知らせ）

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

このたび、新型装置の導入及び一部機器の利用実態を踏まえ、料金の改定等をいたしました。

今後も研究開発支援を通じて、より一層皆様のお役に立てるよう努力してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

#### 記

1 新規導入機器の料金改定について（令和7（2025）年4月1日より適用）

機器名	設置場所	新料金(税抜・1時間)
真空ラミネータ 【ROHM and HAAS 社:VA 7024-HP5】	クリーンルーム B	7,800
反応性イオンエッチング装置 【サムコ(株):RIE-10NR】	クリーンルーム F	10,500

2 その他機器の利用料金について（令和7（2025）年4月1日より適用）

詳細は別添「機器利用料金単価表（新旧対照表）」をご確認ください。

<本件に関するお問い合わせ先>

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団  
三次元半導体センター 管理グループ

担当：蓮實・河津・小野

TEL:092-331-8510 / E-Mail: jiss-itoshima@ist.or.jp

改正案				現行			
三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表 (別紙1) (令和7年4月1日改訂)				三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表 (別紙1) (令和6年3月1日改訂)			
No.	機器名	設置場所	料金(税抜)	No.	機器名	設置場所	料金(税抜)
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	1	基板クランプ機構付き真空式ロールコーター	クリーンルームB	4,600
7	乾燥炉200°C	クリーンルームB	3,000	7	ソルダーレジスト乾燥炉	クリーンルームB	3,000
9	予熱ラミネーター	クリーンルームB	3,200	9	予熱ラミネーター	クリーンルームB	3,200
11	クリーンローラ	クリーンルームB	2,400	11	クリーンローラ	クリーンルームB	2,400
12	真空ラミネータ	クリーンルームB	7,800	12	フィルムレジスト圧着装置	クリーンルームB	6,300
21	プリント基板用直接描画装置	クリーンルームB	29,800	21	プリント基板用直接描画装置 (LI-7F-M)	クリーンルームB	29,800
23	乾燥炉360°C	クリーンルームB	3,000	23	エッチング処理後乾燥炉	クリーンルームB	3,000
23-2	乾燥炉	クリーンルームE	3,000	(追加)	(追加)	(追加)	(追加)
23-3	乾燥炉Si専用	クリーンルームD	3,000	(追加)	(追加)	(追加)	(追加)
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームB	6,900	30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームB	6,900
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	33	AOI(光学式外観検査装置)	クリーンルームB	10,700
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	73	パーティクルカウンター	クリーンルームB	600
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームC	4,100	66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームC	4,100
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームD	5,700	43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームD	5,700
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームD	8,400	44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームD	8,400
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームD	3,000	45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームD	3,000
46	オートマチックサーフェスグラインダー	クリーンルームD	11,500	46	オートマチックサーフェスグラインダー	クリーンルームD	11,500
48	オートマチックダイシングソー	クリーンルームD	7,800	48	オートマチックダイシングソー	クリーンルームD	7,800
49	ストレスリリーフ研磨装置	クリーンルームD	10,300	49	ストレスリリーフ装置	クリーンルームD	10,300
R1	高温クリーンオープン	クリーンルームD	8,500	R1	高温クリーンオープン	クリーンルームD	8,500
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームE	3,600	47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームE	3,600
53	ウェハーカップ式銅メッキ装置	クリーンルームE	14,300	53	ウェハーカップ式銅メッキ装置	クリーンルームE	14,300
55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉	クリーンルームE	8,300	55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉	クリーンルームE	8,300
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	69	超純水製造装置	クリーンルームE	1,200
50	リアクティブイオンエッチャー	クリーンルームF	15,700	50	リアクティブイオンエッチャー	クリーンルームF	15,700
51	絶縁膜形成装置	クリーンルームF	14,700	51	絶縁膜形成装置	クリーンルームF	14,700
52	縦型酸化炉	クリーンルームF	8,200	52	縦型酸化炉	クリーンルームF	8,200
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	54	超小型蒸着装置	クリーンルームF	6,300
65	電界放出型分析走査電子顕微鏡	クリーンルームF	13,300	65	電界放出型分析走査電子顕微鏡システム	クリーンルームF	13,300
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	67	光学顕微鏡	クリーンルームF	1,400

三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表 新旧対照表

改正案				現行			
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	68	実体顕微鏡	クリーンルーム F	1,400
40	微細パターン加工装置	クリーンルーム G	17,300	40	微細パターン加工装置	クリーンルーム G	17,300
41	スピニングコーター	クリーンルーム G	4,900	41	スピニングコーター	クリーンルーム G	4,900
42	アルカリデベロッパ	クリーンルーム G	5,400	42	アルカリデベロッパ	クリーンルーム G	5,400
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	14	アンダーフィル塗布機	実装エリア	1,300
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	15	メタルマスク洗浄装置	実装エリア	1,300
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア	5,300	16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア	5,300
17	プロダクションモジュラー	実装エリア	6,000	17	プロダクションモジュラー	実装エリア	6,000
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	18	導通試験テストデータ加工データ作成装置	実装エリア	3,600
19	大型基板対応フリップチップボンダ	実装エリア	12,200	19	大型基板対応フリップチップボンダ	実装エリア	12,200
24	鉛フリー対応N2リフロー装置	実装エリア	5,800	24	鉛フリー対応N2リフロー装置	実装エリア	5,800
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	26	真空密閉型超音波洗浄装置	実装エリア	5,000
32	内蔵部品検査装置	実装エリア	8,700	32	内蔵部品検査装置	実装エリア	8,700
R5	熱衝撃試験機	実装エリア	1,300	R5	熱衝撃試験機	実装エリア	1,300
13	乾燥炉200℃	水平ライン室	3,000	13	基板処理前乾燥炉	水平ライン室	3,000
27	基板用現像装置	水平ライン室	11,200	27	基板用現像装置	水平ライン室	11,200
28	ソフトエッチ水洗装置	水平ライン室	9,700	28	ソフトエッチ水洗装置	水平ライン室	9,700
29	レジスト剥離装置	水平ライン室	14,500	29	レジスト剥離装置	水平ライン室	14,500
31	基板用ケミカルエッチング装置	水平ライン室	12,900	31	基板用ケミカルエッチング装置	水平ライン室	12,900
25	基板用パフ研磨装置	めっきライン室	7,500	25	基板用パフ研磨装置	めっきライン室	7,500
34	積層前粗化処理装置	めっきライン室	11,700	34	積層前粗化処理装置	めっきライン室	11,700
35	デスマリア装置	めっきライン室	14,200	35	デスマリア装置	めっきライン室	14,200
36	基板用無電解めっき装置	めっきライン室	12,200	36	基板用無電解めっき装置	めっきライン室	12,200
37	電解ピアフィルめっき装置	めっきライン室	12,600	37	電解ピアフィルめっき装置	めっきライン室	12,600
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室	5,900	3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室	5,900
4	プリント基板穴明機	機械加工室	6,500	4	プリント基板穴明機	機械加工室	6,500
5	プリント基板外形加工機	機械加工室	5,400	5	プリント基板外形加工機	機械加工室	5,400
8	ピン立て装置	機械加工室	3,200	8	ピン立て装置	機械加工室	3,200
20	プリント配線板用UV + CO <sub>2</sub> レーザー加工機	機械加工室	15,800	20	プリント配線板用UV + CO <sub>2</sub> レーザー加工機	機械加工室	15,800
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室	8,100	60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室	8,100
61	衝撃試験装置	信頼性試験室	8,300	61	衝撃試験装置	信頼性試験室	8,300
62	自動切断機	信頼性試験室	900	62	自動切断機	信頼性試験室	900
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室	4,100	63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室	4,100
57	ブローピングシステム	電気特性評価室	3,400	57	ブローピングシステム	電気特性評価室	3,400

三次元半導体研究センター 機器利用料金単価表 新旧対照表

改正案				現行			
R3	ブローピングシステム (120GHz)	電気特性評価室	4,200	R3	ブローピングシステム (120GHz)	電気特性評価室	4,200
58	高周波パラメータ測定システム	電気特性評価室	11,900	58	高周波パラメータ測定システム	電気特性評価室	11,900
59	TDRオシロスコープ	電気特性評価室	5,500	59	TDRオシロスコープ	電気特性評価室	5,500
74	基板パラメータ測定システム	電気特性評価室	2,900	74	基板パラメータ測定システム	電気特性評価室	2,900
R2	120GHzネットワークアナライザ	電気特性評価室	33,630	R2	120GHzネットワークアナライザ	電気特性評価室	33,630
R4	ダブルパルステスター	電気特性評価室	5,500	R4	ダブルパルステスター	電気特性評価室	5,500
2	プリント基板真空プレス装置	プレス室	10,700	2	プリント基板真空プレス装置	プレス室	10,700
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	38	自動滴定分析機	分析室	900
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	39	CVS	分析室	2,900
L1	レーザー顕微鏡	検査室	4,700	L1	レーザー顕微鏡	検査室	4,700
L2	フリップチップボンダー	クリーンルームC	11,600	L2	フリップチップボンダー	クリーンルームC	11,600
L3	ワイヤーボンダー	クリーンルームC	5,700	L3	ワイヤーボンダー	クリーンルームC	5,700
L4	ボンドテスタ	クリーンルームC	4,000	L4	ボンドテスタ	クリーンルームC	4,000
L5	FIB	クリーンルームC	13,400	L5	FIB	クリーンルームC	13,400
L7	ウエハープラズマクリーナー	クリーンルームG	5,300	L7	ウエハープラズマクリーナー	クリーンルームC	5,300
80	反応性イオンエッチング装置	クリーンルームF	10,500	L8	酸化膜エッチング装置	クリーンルームC	9,100
L9	ピール試験機	検査室	3,300	L9	ピール試験機	検査室	3,300
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室	2,500	L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室	2,500
s1	ウエハ銅ポストめっき	クリーンルームE	4,300	s1	ウエハ銅ポストめっき	クリーンルームE	4,300
s2	SnAgめっき	クリーンルームE	4,300	s2	SnAgめっき	クリーンルームE	4,300
s3	電解Niめっき	クリーンルームE	25,000	s3	Niめっき	クリーンルームE	4,300
s4	Ni/Auめっき	クリーンルームE	50,800	s4	Ni/Auめっき	クリーンルームE	50,800
81	ドライフィルム剥離	クリーンルームF	3,000	(追加)	(追加)	(追加)	(追加)
s5	チタン/Cu スパッタ	クリーンルームF	40,600	s5	チタン/Cu スパッタ	クリーンルームE	40,600
s6	二流体洗浄装置	クリーンルームE	5,800	s6	二流体洗浄装置	クリーンルームE	5,800
s7	基板用Ni/Auめっき	水平ライン室	102,000	s7	基板用Ni/Auめっき	水平ライン室	102,000
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	s8	PRパルスCu	クリーンルームE	4,300
E43	デジタルマイクロスコープ	クリーンルームC	1,700	E43	デジタルマイクロスコープ	クリーンルームC	1,700

改正案

現行

令和7年4月1日改訂

(別紙2)

三次元半導体研究センター 工賃・技術料について

●技術工賃単価

- ・下記の操作サポート及び受託<sup>※</sup>を除き、36,000円/時  
<sup>※</sup>受託は原則として実施しないが、実施する場合は78,000円/時
- ・従来の技術料は廃止

●操作サポート工賃単価

以下の機器については、操作方法の補助のみの場合、20,000円/時とする。

No.	機器名	設置場所
7	乾燥炉200°C	クリーンルームB
9	予熱ラミネーター	クリーンルームB
11	クリーンローラ	クリーンルームB
23	乾燥炉360°C	クリーンルームB
23-2	乾燥炉	クリーンルームE
23-3	乾燥炉Si専用	クリーンルームD
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームB
(削除)	(削除)	(削除)
(削除)	(削除)	(削除)
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームC
L4	ボンドテスタ	クリーンルームC
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームD
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームD
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームD
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームE
(削除)	(削除)	(削除)
(削除)	(削除)	(削除)
L7	ウェハープラズマクリーナー	クリーンルームG
L1	レーザー顕微鏡	検査室
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室
8	ピン立て装置	機械加工室
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア
(削除)	(削除)	(削除)
32	内蔵部品検査装置	実装エリア
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室
61	衝撃試験装置	信頼性試験室

令和6年3月1日改訂

(別紙2)

三次元半導体研究センター 工賃・技術料について (H29.10.1改定)

(令和6年3月1日改訂)

●技術工賃単価

- ・下記の操作サポート及び受託<sup>※</sup>を除き、36,000円/時  
<sup>※</sup>受託は原則として実施しないが、実施する場合は78,000円/時
- ・従来の技術料は廃止

●操作サポート工賃単価

以下の機器については、操作方法の補助のみの場合、20,000円/時とする。

No.	機器名	設置場所
7	ソルダーレジスト乾燥炉	クリーンルームB
9	予熱ラミネーター	クリーンルームB
11	クリーンローラ	クリーンルームB
23	エッチング処理後乾燥炉	クリーンルームB
(追加)	(追加)	(追加)
(追加)	(追加)	(追加)
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームB
33	AOI(光学式外観検査装置)	クリーンルームB
56	半導体試験装置	クリーンルームC
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームC
I4	ボンドテスタ	クリーンルームC
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームD
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームD
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームD
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームE
67	光学顕微鏡	クリーンルームF
68	実体顕微鏡	クリーンルームF
I7	ウェハープラズマクリーナー	クリーンルームG
I1	レーザー顕微鏡	検査室
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室
8	ピン立て装置	機械加工室
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア
26	真空密閉型超音波洗浄装置	実装エリア
32	内蔵部品検査装置	実装エリア
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室
61	衝撃試験装置	信頼性試験室

三次元半導体研究センター 工賃・技術料について 新旧対照表

改正案			現行		
62	自動切断機	信頼性試験室	62	自動切断機	信頼性試験室
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室	63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室	l10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室
(削除)	(削除)	(削除)	18	導通試験テストデータ加工データ作成装置	研究員室